(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号 特開2001-64255 (P2001-64255A)

(43)公開日 平成13年3月13日(2001.3.13)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	ΡΙ	テーマコート*(参考)
C 0 7 D 209/14	•	C 0 7 D 209/14	
209/10		209/10	
209/96		209/96	
C 0 9 B 23/00		C 0 9 B 23/00	L
			E
	審査請求	未請求 請求項の数15 O	L (全32頁) 最終頁に続く
(21) 川野港昌	#\$#\$#?000_1842Q4(122000_1842Q4)	(71) HISE & 000170004	<u>.</u>

(21)出願番号 特額2000-184294(P2000-184294) (71)出顧人 000179904 山本化成株式会社 山本化成株式会社 大阪府八尾市弓削町南 1 丁目43番地 (72)発明者 藤田 繁雄 大阪府八尾市弓削町南 1 丁目43番地 山本 (32)優先日 平成11年6月21日(1999.6.21) (72)発明者 佐々木 宜明

大阪府八尾市弓削町南1丁目43番地 山本 化成株式会社内

(74)代理人 100085202

弁理士 森岡 博

最終質に絞く

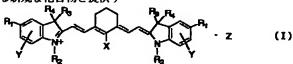
(54) 【発明の名称】 ポリメチン化合物、その製造法及び用途

(57)【要約】

【課題】750nm~900nmに発光領域を持つ半導体レーザー光に対して高い感度を示し、光熱変換効率の高い近赤外線吸収剤、これを用いたダイレクト製阪用印刷原版及びこれらに使用できる新規な化合物を提供す

る.

【解決手段】下記一般式(I)のポリメチン化合物及び該 化合物を含有することを特徴とする近赤外線吸収剤。 【化1】



(式中、R1 は置換基を有してもよいアルコキシ基を示し、R2 は置換基を有してもよいアルキル基を示し、R3、R4 はそれぞれ低級アルキル基を示し、またR3とR4 は互いに連結して環状構造を形成しても良く、Xは

水素原子、ハロゲン原子または置換アミノ基を示し、Y は置換基を有してもよいアルコキシ基または置換基を有 してもよいアルキル基を示し、Zは電荷中和イオンを表 す。) *物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式(I)で表されるポリメチン化合*

1

(式中、R1 は置換基を有してもよいアルコキシ基を示 し、R2は置換基を有してもよいアルキル基を示し、R 3、R4 はそれぞれ低級アルキル基を示し、またR3と 10 R4 は互いに連結して環状構造を形成しても良く、Xは 水素原子、ハロゲン原子または置換アミノ基を示し、Y は置換基を有してもよいアルコキシ基または置換基を有 してもよいアルキル基を示し、Zは電荷中和イオンを表 す。)

【請求項2】R1 が炭素数1~4のアルコキシ基であ り、R2 が炭素数1~8のアルキル基、総炭素数2~8 のアルコキシアルキル基、炭素数1~8のスルホアルキ ル基、または総炭素数2~9のカルボキシアルキル基で あり、Yが炭素数1~4のアルコキシ基または炭素数1 20 ~4のアルキル基である請求項1のポリメチン化合物。 【請求項3】ZがC l ⁻ 、B r ⁻ 、I ⁻ 、C l O₄ ⁻ 、 BF_4 ~ CF_3 CO_2 ~ PF_6 ~ SbF_6 ~ CH₃ SO₃ - またはp-トルエンスルホネート、N a+、K+ またはトリエチルアンモニウムイオンである 請求項1または2のポリメチン化合物。

【請求項4】R3、R4 がメチル基、R3 とR4 が互い に連結して形成されたシクロペンタン環またはR3 とR 4 が互いに連結して形成されたシクロヘキサン環である 請求項1~3いずれかのポリメチン化合物。

【請求項5】XがH、C1、Brまたはジフェニルアミ ノ基である請求項1~4いずれかのポリメチン化合物。 【請求項6】Cu-Ka線による粉末X線回折法におけ る回折角(20±0.2°)11.6°、14.6°、1 5.6°、19.6°、22.9°に特徴的なピークを 示す粉末X線回折図により特徴づけられる下記式で表さ れる2-(2-{2-クロロ-3-[(1,3-ジヒドロ -3, 3, 7-トリメチル-5-メトキシ-1-メトキ シエチルー2Hーインドールー2ーイリデン)エチリデ ン] -1-シクロヘキセン-1-イル} エテニル)-**3, 3, 7ートリメチルー5ーメトキシー1ーメトキシ** エチルインドリウム=テトラフルオロボレートの低融点 結晶変態である請求項1のポリメチン化合物。

【化2】

【請求項7】Cu-Kα線による粉末X線回折法におけ※50 物である請求項1のポリメチン化合物。

%る回折角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ})$ 8.4° に特徴的な非常に強 いピークを示す粉末X線回折図により特徴づけられる下 記式で表される2-(2-{2-/ロロ-3-[(1,3 ージヒドロー3, 3, 7ートリメチルー5ーメトキシー 1-メトキシエチルー2H-インドールー2-イリデ ン)エチリデン] -1-シクロヘキセン-1-イル} エ テニル)-3,3,7-トリメチル-5-メトキシ-1 ーメトキシエチルインドリウム=テトラフルオロボレー トの高融点結晶変態である請求項1のポリメチン化合 物。

【化3】

【請求項8】Cu-Kα線による粉末X線回折法におけ る回折角(20±0.2°)13.3°、17.4°、1 9.8°、21.8°、26.9°に特徴的なピークを 示す粉末X線回折図により特徴づけられる下記式で表さ れる2-(2-{2-クロロ-3-[(1,3-ジヒドロ -3, 3, 7-トリメチル-5-メトキシ-1-メトキ 30 シエチルー2Hーインドールー2ーイリデン)エチリデ ン] -1-シクロヘキセン-1-イル} エテニル)-3,3,7-トリメチルー5-メトキシー1-メトキシ エチルインドリウム=テトラフルオロボレートの結晶性 メタノール付加物である請求項1のポリメチン化合物。 【化4】

Calladona

【請求項9】Cu-Ka線による粉末X線回折法におけ る回折角 $(2\theta\pm0.2^{\circ})$ に特徴的なピークを示さない 粉末X線回折図により特徴づけられる下記式で表される 2-(2-(2-/ロロ-3-[(1, 3-ジヒドロ-3, 3, 7ートリメチルー5ーメトキシー1ーメトキシ エチルー2H-インドールー2-イリデン)エチリデ ン] -1-シクロヘキセン-1-イル} エテニル)-3, 3, 7-トリメチルー5-メトキシー1-メトキシ エチルインドリウム=テトラフルオロボレートの無定形

【請求項10】下記一般式(II)で表されるインドレニウム化合物と、下記一般式(III)で表されるジホルミル化合物または(IV)で表されるジアニル化合物を脂肪酸塩の存在下、脱水性有機酸を用いて縮合させることを特徴と 10 する請求項1のポリメチン化合物の製造方法。

【化6】

(式中、R1 は置換基を有してもよいアルコキシ基を示し、R2 は置換基を有してもよいアルキル基を示し、R3、R4 はそれぞれ低級アルキル基を示し、またR3と 20 R4 は互いに連結して環状構造を形成しても良く、Yは置換基を有してもよいアルコキシ基または置換基を有してもよいアルキル基を示し、Z1 は電荷中和イオンを表わし、nはOまたは1の数を表す。)

【化7】

(式中、Xは水素原子、ハロゲン原子または置換アミノ 基を示す。)

【化8】

(式中、Xは水素原子、ハロゲン原子または置換アミノ 基を示す。)

【請求項11】請求項1記載のポリメチン化合物の結晶 性溶媒付加物または無定形物を溶剤処理することを特徴 とする請求項1記載のポリメチン化合物の低融点結晶物 の製造方法。

【請求項12】請求項1記載のポリメチン化合物をケトン系またはアルコール系溶剤で再結晶することを特徴とする請求項1記載のポリメチン化合物の高融点結晶物の製造方法。

【請求項13】請求項1記載のポリメチン化合物を含有 することを特徴とする近赤外線吸収剤。

【請求項14】支持体上に光熱変換層を設けてなるダイレクト製版用印刷原版において、光熱変換層中に請求項1のポリメチン化合物を含有することを特徴とするダイレクト製版用印刷原版。

【請求項15】請求項14のダイレクト製版用印刷原版 に、光源として750nm~900nmに発光領域を持つ半導体レーザー光を照射して印刷版を作製する方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規なポリメチン化合物、その製造方法及びこれを含有する近赤外線吸収剤に関する。本発明のポリメチン化合物は750~900 nmの近赤外領域に吸収を有し、レーザー光を利用した画像記録に用いられる近赤外線吸収剤として、例えばレーザー光を利用した製版用途やレーザー感熱記録材料用途の近赤外線吸収剤として利用できるほか、電子写真やハロゲン化銀写真用の分光増感色素、光ディスク用色素等としても利用することができる。

[0.002]

【従来の技術】近年、レーザー技術の発達に伴い、高速 記録や高密度、高画質記録を目的にレーザー光を利用し て画像を記録する方式、例えばレーザー光を熱に変換し て記録する方式として、レーザー感熱記録材料、レーザ 一熱転写記録材料等の画像形成方法が検討されている。 また、コンピューターの普及やデジタル画像処理技術の 向上等のエレクトロニクスの急速な発展を背景に、デジ タルデータからダイレクトに印刷原版を作製する、所謂 コンピューター・ツー・プレート技術(CTP製版技術) の開発が活発に検討されている。

【0003】レーザー光を熱に変換して画像を記録する方式(レーザーサーマル記録方式)においては、レーザーの波長に合った光吸収剤を使用し、吸収した光を熱に変換し画像を形成することが行われているが、レーザーの30出力を相当大きくしないと画像形成に必要な熱エネルギーが得られず、光熱変換効率のよい光吸収剤の開発が望まれている。レーザー 恩熱記録材料においては、一般に750nm~900nmの近赤外域に発光領域を持つ半導体レーザーが使用されているが、レーザーの波長に合った近赤外線吸収剤は一般的に可視域の光をも吸収するため地肌が着色してしまう欠点があり、可視域の光の吸収が小さい近赤外線吸収剤が望まれている。

【0004】CTP製販技術においては、製販方法から分類すると、レーザー光を照射する方法、サーマルヘッドで書き込む方法、ピン電極で電圧を部分的に印加する方法、インクジェットでインキ反飛またはインキ着肉層を形成する方法などが知られている。なかでも、レーザー光を用いる方法は解像度、および製販速度の面で他の方式よりも優れており、種々の画像形成方法が検討されている。

【0005】また、最近では近赤外域(750nm~900nm)に発光領域を持つ小型で高出力で安価な半導体レーザーが容易に入手できるようになってきており、 半導体レーザーが製販する際の露光光源として有用となってきている。 【0006】レーザー光を利用するダイレクト製版としては、感光性タイプ及び感熱性タイプがある。感光性タイプの版材としては、有機半導体(OPC)を用いる電子写真方式、銀塩を用いる銀塩方式等があるが、これらの版材は、その製造装置が大型かつ高価であり、版価格が従来のPS版(presensitized plate)に比べ割高である。また、現像液の廃棄処理問題も有する。

【0007】感熱性タイプの版材は、感光性タイプの版材に比べ感度が低い事が欠点であるが、通常の室内(明室)で取り扱え、装置が小型で安価であることから精力的に検討されている。

【0008】 感熱性タイプの版材は、いずれも光を熱に変換するための光熱変換層を必要とする。この光熱変換層は、光熱変換剤、例えば近赤外線吸収剤を含有するが、この光熱変換剤は使用するレーザー光を吸収することが必須であり、 感度を向上させるためには、使用するレーザー光の吸収能力及び光熱変換効率がより高いことが必要である。

【0009】光熱変換剤としては、顔料タイプ及び染料タイプの物質があるが、顔科タイプの物質としては、通 20 常カーボンブラックが用いられており、染料タイプの物質としては、種々提案されているが、通常ボリメチン化合物が用いられている。カーボンブラックは使用レーザーの選択の幅が広いが、染料タイプの物質に比べ、一般にレーザー光の吸収能力が低く、使用量を多くしなけれ*

*ばならない。また高度な分散技術が必要となる。

【0010】染料タイプの物質を使用する場合には、使 用レーザー光の吸収能力が高いこと、画像形成成分、樹 脂バインダー等の他の成分との相溶性や使用する溶剤へ の溶解性が良いことが必要となる。

【0011】ポリメチン化合物は分子内に共役二重結合で結ばれたメチン鎖を有し、可視域から近赤外域(340~1,400nm)の幅広い領域に吸収を持ち、吸収極大の吸光係数が大きいことなどから銀塩写真用感光色素、電子写真用感光色素、レーザー記録用色素、レーザー発振用色素等多くの分野で利用されている。

【0012】ポリメチン化合物はレーザー光の吸収能力は高いが使用レーザー光とのマッチングが必要であり、一般に公知の化合物は光安定性が低く、画像形成物質、バインダー樹脂等との相性が悪いという問題が有る。【0013】ポリメチン化合物としてすでに多くの化合物が知られており、耐久性を向上する手段としてメチン鎖の一部に環状構造を導入した化合物が知られている。例えば、化合物Aが特開昭63-319191号公報、P3の具体例化合物9において、化合物BがJournal of Organic Chemistry, 60, 2392, Table1. において公知である。

【0014】 【化9】

【0016】しかし、化合物A、化合物Bはともに最大吸収波長が785~815 n mの範囲にあり、現在最も使用が検討されている820~840 n mに発光領域を持つ小型で高出力なレーザーに対する感度が不十分である。また、化合物A、化合物Bはともには溶剤溶解性や機能との相溶性が低く、使用できるバインダー機能等が制限される欠点がある。

[0017]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、可視域の光の吸収が小さく、近赤外域(750nm~900nm)に発光領域を持つ半導体レーザー、特に820nm~840nmのレーザーに対する感度が高く、近赤外線吸収剤、レーザーサーマル記録材料やダイレクト製版用印刷原販等の光熱変換層に好適なポリメチン化合物を★50

★提供することである。

[0018]

【課題を解決するための手段】前記した課題を解決するために種々検討した結果、本発明者らは、新規なポリメチン化合物が、可視域の光の吸収が小さく、近赤外域(750nm~900nm)に発光領域を持つ半導体レーザーに対する感度が良好で光熱変換効率が高く、種々の用途への加工が容易な近赤外線吸収剤として使用し得ることを見い出し、本発明を達成することができた。

【0019】本願の第一の発明は、下記一般式(I)で表わされるポリメチン化合物である。

[0020]

【化11】

(式中、R1 は置換基を有してもよいアルコキシ基を示 し、R2は置換基を有してもよいアルキル基を示し、R 3、R4はそれぞれ低級アルキル基を示し、またR3と R4 は互いに連結して環状構造を形成しても良く、Xは 水素原子、ハロゲン原子または置換アミノ基を示し、Y 10 は置換基を有してもよいアルコキシ基または置換基を有 してもよいアルキル基を示し、Zは電荷中和イオンを表 す。)本願の第二の発明は、下記式で表わされるポリメ チン化合物の結晶変態、結晶性メタノール付加物及び無 定形物である。

[0021]

【化12】

【0022】本願の第三の発明は、一般式(II)で表され るインドレニウム化合物と、下記一般式(III)で表され るジホルミル化合物または(IV)で表されるで表されるジ アニル化合物を脂肪酸塩の存在下、脱水性有機酸を用い て縮合させることを特徴とする前記一般式(I)のポリメ チン化合物の製造方法である。

[0023]

【化13】

(式中、R1 は置換基を有してもよいアルコキシ基を示 し、R2は置換基を有してもよいアルキル基を示し、R 3、R4 はそれぞれ低級アルキル基を示し、またR3と R4 は互いに連結して環状構造を形成しても良く、Yは 置換基を有してもよいアルコキシ基または置換基を有し 40 エチルー2H-インドールー2ーイリデン)エチリデ てもよいアルキル基を示し、Z1は電荷中和イオンを表 わし、nは0または1の数を表す。)

[0024]

【化14】

*(式中、Xは水素原子、ハロゲン原子または置換アミノ 基を示す。)

[0025]

【化15】

(式中、Xは水素原子、ハロゲン原子または置換アミノ 基を示す。)

本願の第四の発明は、上記第一の発明のポリメチン化合 物をケトンまたはアルコール溶剤で再結晶することを特 徴とする高融点結晶物の製造方法である。

【0026】本願の第五の発明は、上記第一の発明のポ リメチン化合物の結晶性溶媒付加物または無定形物を特 20 定溶剤で処理することを特徴とする低融点結晶物の製造 方法である。本願の第六の発明は、上記第一の発明のポ リメチン化合物を含有することを特徴とする近赤外線吸 収剤である。

【0027】本願の第七の発明は、支持体上に光熱変換 層を設けてなるダイレクト製販用印刷原販において、光 熱変換層中に上記第一の発明のポリメチン化合物を含有 することを特徴とするダイレクト製版用印刷原版であ る。

【0028】本願の第八の発明は、上記第七の発明のダ 30 イレクト製版用印刷原版に、光源として750nm~9 00 nmに発光領域を持つ半導体レーザー光を照射して 印刷版を作成する方法である。

[0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳しく説明 する.

[ポリメチン化合物] まず、本発明の第一、第二の発明 である下記一般式(I)で表されるポリメチン化合物及び 2-(2-{2-クロロ-3-[(1, 3-ジヒドロ-3, 3, 7-トリメチルー5-メトキシー1-メトキシ ン] -1-シクロヘキセン-1-イル} エテニル)-3, 3, 7-トリメチルー5-メトキシー1-メトキシ エチルインドリウム=テトラフルオロボレート(具体例 化合物(55))の結晶変態、結晶性メタノール付加物及 び無定形物について以下に説明する。

[0030]

【化16】

(式中、R1 は置換基を有してもよいアルコキシ基を示 し、R2は置換基を有してもよいアルキル基を示し、R 3、R4 はそれぞれ低級アルキル基を示し、またR3 と R4 は互いに連結して環状構造を形成しても良く、Xは 水素原子、ハロゲン原子または置換アミノ基を示し、Y 10 が好ましく、炭素数1~8の直鎖或いは分岐のスルホア は置換基を有してもよいアルコキシ基または置換基を有 してもよいアルキル基を示し、Zは電荷中和イオンを表 す。) R1 が無置換のアルコキシ基であるものとして は、炭素数1~8のものが好ましく、特に炭素数1~4 のものが好ましい。

【0031】R1が置換基を有するアルコキシ基である 場合、置換基としては、アルキルオキシ基、アルキルチ オ基、水酸基、ハロゲン原子等が挙げられ、アルキルオ キシ基が好ましい。R1 がアルキルオキシ基を有するア ルコキシであるものとしては、総炭素数2~8のものが 20 キシル基、8-スルホオクチル基、6-スルホー2-エ 好ましく、特に総炭素数2~4のものが好ましい。

【0032】R1の例として、メトキシ基、エトキシ 基、nープロポキシ基、isoープロポキシ基、nーブ トキシ基、iso-ブトキシ基、sec-ブトキシ基、 nーペントキシ基、isoーペントキシ基、nーオクチ ルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、メトキシメ トキシ基、2-メトキシエトキシ基、2-エトキシエト キシ基が挙げられる。

【0033】R2が置換基を有さないアルキル基である 場合は、炭素数1~18の直鎖或いは分岐のアルキル基 30 ンと塩を形成しているものが好ましい。例としては2-が好ましく、炭素数1~8の直鎖或いは分岐のアルキル 基が特に好ましい。例としてはメチル基、エチル基、n ープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブ チル基、sec-ブチル基、n-ペンチル基、イソペン チル基、ネオペンチル基、ローヘキシル基、イソヘキシ ル基、sec-ヘキシル基、2-エチルブチル基、n-ヘプチル基、イソヘプチル基、sec-ヘプチル基、n -オクチル基、2-エチルヘキシル基、n-デシル基、 nードデシル基、nーペンタデシル基、nーオクタデシ ル基が挙げられる。

【0034】R2 が置換基を有するアルキル基であるも のとしてはアルコキシアルキル基、スルホアルキル基、 カルボキシアルキル基等が挙げられるが、アルコキシア ルキル基である場合は、総炭素数2~8のものが好まし い。例として2-メトキシエチル基、3-メトキシプロ ピル基、4ーメトキシブチル基、2-エトキシエチル 基、3-エトキシプロビル基、4-エトキシブチル基、 2-n-プロポキシエチル基、2-iso-プロポキシ エチル基、3-n-プロポキシプロピル基、4-n-プ ロポキシブチル基、2ーメトキシー2ーエトキシエチル*50

*基、2-エトキシ-2-エトキシエチル基が挙げられ る.

【0035】R2がスルホアルキル基であるものとして は炭素数1~18の直鎖或いは分岐のスルホアルキル基 ルキル基が特に好ましい。また、これらスルホアルキル 基であるR2の少なくとも一つがアルカリ金属イオンま たはアルキルアンモニウムイオンと塩を形成しているも のが好ましい。例としては2-スルホエチル基、3-ス ルホプロピル基、3-スルホブチル基、4-スルホブチ ル基、4-スルホー3ーメチルブチル基、2-(3-ス ルホプロポキシ)エチル基、2-ヒドロキシ-3-スル ホプロビル基、3-スルホー2-(2-エトキシ)エトキ シプロポキシ基、5-スルホペンチル基、6-スルホヘ チルヘキシル基が挙げられ、アルカリ金属イオンまたは アルキルアンモニウムイオンと塩を形成していてもよ

【0036】R2 がカルボキシアルキル基であるものと しては、総炭素数2~18の直鎖或いは分岐のカルボキ シアルキル基が好ましく、総炭素数2~9の直鎖或いは 分岐のカルボキシアルキル基が特に好ましい。また、こ れらカルボキシアルキル基であるR2の少なくとも一つ がアルカリ金属イオンまたはアルキルアンモニウムイオ カルボキシエチル基、3ーカルボキシプロピル基、3ー カルボキシブチル基、4ーカルボキシブチル基、4ーカ ルボキシー3ーメチルブチル基、2-(3-カルボキシ プロポキシ)エチル基、2-ヒドロキシ-3-カルボキ シプロピル基、3ーカルボキシー2-(2-エトキシ)エ トキシプロポキシ基、5-カルボキシペンチル基、6-カルボキシヘキシル基、8-カルボキシオクチル基、6 -カルボキシ-2-エチルヘキシル基が挙げられ、アル カリ金属イオンまたはアルキルアンモニウムイオンと塩 40 を形成していてもよい。

【0037】R3、R4が低級アルキル基であるものの 例としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソ プロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブ チル基が挙げられる。

【0038】R3、R4が互いに連結して形成した環状 構造の例としては、シクロプロパン環、シクロブタン 環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロヘブ タン環が挙げられるが、特にシクロブタン環、シクロペ ンタン環、シクロヘキサン環が好ましい。

【0039】Xは水素原子、F、C1、Br、Iなどの

ハロゲン原子、エチルアミノ基、フェニルアミノ基、ジ フェニルアミノ基、モルホリノ基などの置換アミノ基が 好ましく、C1、Br、ジフェニルアミノ基が特に好ま しい。

【0040】Yが無置換のアルコキシ基であるものとし ては、炭素数1~8のものが好ましく、特に炭素数1~ 4のものが好ましい。

【0041】Yが置換基を有するアルコキシ基である場 合、置換基としては、アルキルオキシ基、アルキルチオ 基、水酸基、ハロゲン原子等が挙げられが、特にアルキ 10 エトキシエチル基、2-エトキシ-2-エトキシエチル ルオキシ基が好ましい。Yがアルキルオキシ基を置換基 として有するアルコキシ基である場合、総炭素数2~8 のものが好ましく、特に絃炭素数2~4のものが好まし

【0042】このようなYがアルコキシ基である例とし ては、メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、i soープロポキシ基、nーブトキシ基、isoーブトキ シ基、secーブトキシ基、nーペントキシ基、iso ーペントキシ基、n-オクチルオキシ基、2-エチルへ キシルオキシ基、2-メトキシエトキシ基、2-エトキ 20 K+、トリエチルアンモニウムイオンが好ましい。 シエトキシ基が挙げられる。

【0043】Yが置換基を有さないアルキル基である場 合は、炭素数1~8の直鎖或いは分岐のアルキル基が好 ましく、炭素数1~4の直鎖或いは分岐のアルキル基が 特に好ましい。例としてはメチル基、エチル基、n-プ ロビル基、イソプロビル基、nーブチル基、イソブチル 基、secーブチル基、nーペンチル基、イソペンチル 基、ネオペンチル基、n−ヘキシル基、イソヘキシル 基、secーヘキシル基、2-エチルブチル基、n-ヘ プチル基、イソヘプチル基、sec-ヘプチル基、n-30 の化合物の範囲はこれらに限定されるものではない。 オクチル基、2-エチルヘキシル基が挙げられる。

【0044】Yが置換基を有するアルキル基である場 合、置換基としては、アルキルオキシ基、アルキルチオ 基、水酸基、ハロゲン原子等が挙げられが、特にアルキ ルオキシ基が好ましい。Yがアルキルオキシ基を置換基 として有するアルキル基である場合は、総炭素数2~4 のものが好ましい。例として2-メトキシエチル基、3 -メトキシプロビル基、4-メトキシブチル基、2-エ トキシエチル基、3-エトキシプロピル基、4-エトキ シブチル基、2-n-プロポキシエチル基、2-iso ープロポキシエチル基、3-n-プロポキシプロピル 基、4-n-プロポキシブチル基、2-メトキシ-2-

12

【0045】Zは電荷中和イオンを表し、例えばF-、 C1-, Br-, I-, BrO₄-, C1O₄-, p-トルエンスルホネート、CH3 SO3 - 、BF4 - 、 CH₃ CO₂ - CF₃ CO₂ - PF₆ - SbF₆ - 、Na+、K+、トリエチルアンモニウムイオンが挙 げられ、特に、C1-、Br-、I-、C1O4-、p ートルエンスルホネート、CH3 SO3 - 、BF4 - 、 CF_3CO_2 - PF_6 - SbF_6 -Na+【0046】Z1は電荷中和イオンを表し、例えば F-, C1-, Br-, I-, BrO₄-, C1 O4 - 、pートルエンスルホネート、CH3 SO 3 - \ BF4 - \ CH3 CO2 - \ CF3 CO2 - \ PF6-、SbF6-が挙げられ、特に、C1-、Br - 、I - 、C 1 O4 - 、p ートルエンスルホネート、C $H_3 SO_3$ - BF_4 - $CF_3 CO_2$ - PF_6 -

SbF6 - が好ましい。本発明の一般式(I)で表される

ポリメチン化合物の好ましい具体例を下記に示すが、そ

[0047]

基が挙げられる。

【化17】

14 化合物 (1)

[0048]

* *【化18】

16 化合物 (7)

[0049]

[0050]

* *【化20】

[0051]

*【化21】

[0052]

* *【化22】

化合物 (31) CHAO HO CHA CIQE MOCHA CIQE

[0053]

30【化23】

(比合物 (37) Hugo Hugo Cally Cal

化合物 (38) H₄CO H₄COH₅ COH₅ CO

化合物 (39) H₂CO H₂CO H₃CO H₃CO

化合物(4 0)
HCCO HCCOH₂
ClQ
ClQ
ClQ
ClQ
ClQ

化合物 (41) H_CCOH₆ H_CCOH₆ OCH₆ OCH₆

化合物 (4 2) H_CCCH₃ H_CCCH₃ OCH₃ H_CCCH₁₇ OCH₃

【0054】 * * 【化24】

[0055]

[0056]

30【化26】

31 32 化合物 (55)

[0057]

*【化27】

34 化合物 (61)

化合物 (62)

化合物 (63)

化合物 (64)

化合物 (65)

なお、上記具体例の化合物(1)~(65)中、下記の一般 式(V)にて表記した化合物は、一般式(VI)でも表すこと ができる。

* [0058] 【化28】

[0059] 【化29】 (N)

(式中、R₁~R₄、X及びYは前記と同じものを示 し、MはNa、Kまたはトリエチルアンモニウムを表 す。)

例えば、具体例化合物(51)は [0060] 【化30】

と表すこともできる。

40 【0061】本発明の一般式(I)で表されるポリメチン 化合物には結晶変態、結晶性溶媒付加物及び無定形物が 存在するものがある。例えば、具体例化合物(55)には Cu-Ka線による粉末X線回折法における回折角(2 $\theta \pm 0.2^{\circ}$)11.6°, 14.6°, 15.6°, 19.6°、22.9°に特徴的なピークを示すα晶 (低融点化合物)、回折角 $(2\theta\pm0.2^{\circ})8.4^{\circ}$ に特 徴的な非常に強いビークを示すβ晶(高融点化合物)、回 折角(2θ±0.2°)13.3°、17.4°、19. 8°、21.8°、26.9°に特徴的なピークを示す 50 結晶性メタノール付加物及び回折角 $(2\theta\pm0.2^{\circ})$ に 特徴的なピークを示さない無定形物が存在する。

【0062】[ポリメチン化合物及び結晶変態の製造方 法] 本発明のポリメチン化合物は、例えば一般式(II)で 表されるインドレニウム系化合物と、一般式(III)で表 されるジホルミル系化合物または(IV)で表されるジアニ ル系化合物を脂肪酸塩の存在下、脱水性有機酸中にて縮 合させることにより製造される。

[0063]

【化31】

$$\begin{array}{c|c} R_1 & R_0 \\ \hline R_1 & R_0 \\ \hline R_1 & CH_0 & (Z_1)n & (II) \\ \hline R_2 & CH_0 & (Z_1)n & (II) \\ \hline \end{array}$$

(式中、R₁ ~R₄、Y、Z₁ 及びnは前記と同じもの を示す。)

[0064]

【化32】

(式中、Xは前記と同じものを示す。)

[0065]

【化33】

(式中、Xは前記と同じものを示す。)

上記縮合反応において、脂肪酸塩としては、例えば、酢 オン酸ナトリウム、プロピオン酸カリウム等が挙げられ

【0066】かかる脂肪酸塩は、一般式(II)で表される 化合物1モル当たり通常0.1~5モル程度、好ましく は0.5~2モル程度使用する。

【0067】脱水性有機酸としては、無水酢酸、無水ブ ロピオン酸、無水酪酸、アーブチロラクトン等が挙げら れる.

【0068】かかる脱水性有機酸は、一般式(II)で表さ ましくは20~50モル程度使用する。

【0069】一般式(II)で表される化合物と一般式(II I)または(IV)で表される化合物との使用割合は、通常前 者1モルに対し後者を0.2~1.5モル程度、好まし くは0.4~0.7モル程度使用する。

【0070】上記反応は通常10~150℃程度、好ま しくは室温~120℃で好適に進行し、一般に数分~3 時間程度で完結する。

【0071】反応後、例えば、水やメタノール、エタノ

ブタノール等の貧溶媒を注入したり、あるいは水やメタ ノール、エタノール、nープロパノール、isoープロ 反応混合物から目的物を容易に単離することがでる。ま た、慣用の精製手段、例えば、再結晶、カラム分離等に より容易に精製することができる。

36

【0072】本発明の一般式(1)で表されるポリメチン 化合物には結晶変態、結晶性溶媒付加物及び無定形物が 存在するものがあり、精製前の単離方法及び/または精 10 製方法によっては、結晶変態、結晶性溶媒付加物及び無 定形物となったり、結晶変態、結晶性溶媒付加物及び無 定形物の混合物となったりする。

【0073】本発明のポリメチン化合物において、例え ば、低融点化合物は、結晶性溶媒付加物または無定形物 を特定の溶剤、すなわちケトン、アルコール、またはこ れらとエステル及び/またはエーテルとの混合溶剤と接 触させるなどの溶剤処理を行うことにより製造できる。 かかる処理を行うには、例えば再結晶操作とならない条 件、すなわち固形のポリメチン化合物が完溶しない溶媒 20 使用量と温度に設定した溶剤中にポリメチン化合物を分 散するのが好ましい。接触処理としてはポリメチン化合 物を溶剤中に分散させるほか、単にポリメチン化合物と 溶剤を接触させるだけであってもよい。

【0074】高融点化合物は熱的に安定な結晶形であ り、低融点化合物、結晶性溶媒付加物、無定形物、また は低融点化合物、高融点化合物、結晶性溶媒付加物、無 定形物の混合物を完全に溶解することのできる溶剤、例 えばケトン、アルコール、またはケトンとアルコールの 混合溶剤を用いた再結晶法により製造できる。再結晶を 酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸カルシウム、プロピ 30 行うには、ポリメチン化合物を溶剤に完全に溶解させた 後、ゆっくりと熟成させながら晶析させたり、種晶を添 加することが好ましい。

【0075】かかる接触処理、再結晶に用いるケトンと しては、カルボニル基を有する種々の溶剤、例えば、ア セトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、 メチルブチルケトン、メチルイソプロピルケトン、メチ ルアミルケトン、ジエチルケトン、エチルプチルケト ン、ジプロピルケトン、ジイソプロピルケトン、ジアセ トンアルコール、シクロヘキサノンなどが挙げられる。 れる化合物1モル当たり通常10~100モル程度、好 め またアルコールとしては、例えば、メタノール、エタノ ール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタ ノール、イソブタノール、sec-ブタノール、ter tーブタノール、n-アミルアルコール、メチルアミル アルコール、2-エチルヘキサノール、n-オクタノー ル、シクロヘキサノール、2-エチルシクロヘキサノー ルなどが挙げられる。また、接触処理に用いるエステル としては、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸n-プロピ ル、酢酸イソプロピル、酢酸n-ブチル、酢酸イソアミ ル、酪酸nーブチルなどが挙げられ、エーテルとして ール、nープロバノール、isoープロバノール、n- 50 は、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、nーブ チルエーテル、ジグライムなどが挙げられる。

【0076】低融点化合物を作製するにあたり接触処理に用いる溶剤の使用量は、ボリメチン化合物に対する溶解度によって異なり、ボリメチン化合物が完溶しない範囲で、ボリメチン化合物に対し2~70倍重量比、好ましくは3~50倍重量比使用する。使用量がこれより多いと収量が少なくなり効率が悪い。処理温度は使用溶剤によって異なるが、一般に−10°~70℃程度、好ましくは0°~50℃である。分散処理溶剤にはエステル及び/またはエーテル等の貧溶剤を混合して用いること 10もできる。

【0077】高融点化合物を作製する場合の再結晶溶媒の使用量も、ボリメチン化合物に対する溶解度によって異なり、ボリメチン化合物が完溶する範囲で、ボリメチン化合物に対し3~100倍重量比、好ましくは5~70倍重量比使用する。使用量が少なすぎると結晶性溶媒付加物となる場合がある。使用量がこれより多いと収量が少なくなり効率が悪くなる。再結晶温度は使用溶剤によって異なるが、一般に20°~150℃程度、好ましくは30°~120℃である。再結晶溶剤にはケトンと20アルコールの混合溶剤を用いることもできる。

【0078】本発明の式(I)で表される化合物のうち、 例えば

[0079]

は、粉末X線の回折パターンの異なる低融点化合物(融点;195~197℃α晶)、高融点化合物(融点;204~206℃ β晶)、結晶性メタノール付加物及び無定形物が存在する。上記ポリメチン化合物は、精製前の単離方法及び/または精製方法によって、低融点化合物、高融点化合物となるほか、結晶性溶媒付加物や無定形物となったり、低融点化合物、高融点化合物、結晶性溶媒付加物及び無定形物の混合物となったりする。

【0080】低融点化合物及び高融点化合物は前記の方法により製造することができる。また、結晶性メタノー 40ル付加物は、高融点化合物、低融点化合物、無定形物及び/またはそれらの混合物をメタノールに溶解後、減圧下濃縮し、濃縮残量を固形物に対し2~5倍量とした後、沪取することにより製造できる。無定形物は単離した高融点化合物、低融点化合物、結晶性メタノール付加物、無定形物またはそれらの混合物をアセトンに完全に溶解後、減圧下で濃縮、乾燥することにより製造できる。

【0081】一般式(II)で表される化合物は、例えば特が、特にメタノール、エタノール、プロパノール等のア開平1-131277号公報等に記載の方法で合成する 50 ルコール系溶剤やメチルセロソルブ、エチルセロソルブ

ことができる。

【0082】一般式(III)で表されるジホルミル系化合物は、例えばJournal of Organic Chemistry,42,885-88 8(1977)等に記載の方法で合成することができる。一般式(IV)のジアニル系化合物は一般式(III)のジホルミル系化合物とアニリン塩酸塩を反応させることにより容易に合成することができる。

【0083】[近赤外線吸収剤]本発明の近赤外線吸収 剤は、式(I)のポリメチン化合物以外にバインダー樹脂 等を含有してもよい。

【0084】近赤外線吸収剤としては一般式(I)のポリメチン化合物以外に、本発明の目的を逸脱しない範囲で、公知の種々の近赤外線吸収剤が併用できる。

【0085】併用できる近赤外線吸収剤としては、カーボンブラック、アニリンブラック等の顔料や『化学工業(1986年、5月号)』の「近赤外吸収色素」(P45~51)や『90年代 機能性色素の開発と市場動向』シーエムシー(1990)第2章2.3に記載されているボリメチン系色素(シアニン色素)、フタロシアニン系色素、ジチオール金属錯塩系色素、ナフトキノン、アントラキノン系色素、トリフェニルメタン(類似)系色素、アミニウム、ジインモニウム系色素等、またアゾ系色素、インドアニリン金属錯体色素、分子間型CT色素等の顔料、染料系の色素が挙げられる。

【0086】バインダー樹脂としては、特に制限はないが、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、サクリル酸エステル、サルセルロース、エチルセルロース、セルロースアセテートのようなセルロ30 ース系ポリマー、ボリスチレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルブチラール、ボリビニルアルコールのようなビニル系ポリマー及びビニル化合物の共重合体、ポリエステル、ボリアミドのような縮合系ポリマー、ブタジエンースチレン共重合体のようなゴム系熱可塑性ポリマー、エポキシ化合物などの光重合性化合物を重合・架橋させたポリマーなどを挙げることができる。

【0087】本発明の近赤外線吸収剤を光カード等の光記録材料に用いる場合は、例えばガラス、プラスチック樹脂等の基板上に、近赤外線吸収剤と有機溶剤を溶解した液をスピンコート法等の従来から種々検討されている方法で塗布することにより作製できる。基板に使用できる樹脂としては、特に制限はないが、例えばアクリル樹脂、ボリエチレン樹脂、塩化ビニール樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ボリカーボネート樹脂等が挙げられる。スピンコートに用いる溶剤としては、特に制限はないが、例えば炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、エーテル類、ケトン類、アルコール類、セロソルブ類が挙げられるが、特にメタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール系溶剤のメチルセロソルブ

等のセロソルブ系溶剤が好ましい。

【0088】本発明の近赤外線吸収剤を近赤外線吸収フ ィルター、熱線遮断材、農業用フィルムに用いる場合 は、近赤外線吸収剤にプラスチック樹脂及び場合により 有機溶剤と混合し、射出成形法やキャスト法等の従来か ら種々検討されている方法で板状若しくはフィルム状に することにより作製できる。使用できる樹脂としては、 特に制限はないが、例えばアクリル樹脂、ポリエチレン 樹脂、塩化ビニール樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリカ ーボネート樹脂等が挙げられる。用いる溶剤としては、 特に制限はないが、例えば炭化水素類、ハロゲン化炭化 水素類、エーテル類、ケトン類、アルコール類、セロソ ルブ類が挙げられるが特に、メタノール、エタノール、 プロパノール等のアルコール系溶剤やメチルセロソル ブ、エチルセロソルブ等のセロソルブ系溶剤が好まし

【0089】本発明の近赤外線吸収剤をレーザー熱転写 記録材料、レーザー感熱記録材料等の記録材料に用いる 場合は、近赤外線吸収剤に発色成分または着色成分等を 配合して使用してもよいし、発色成分または着色成分等 20 を含有する層を別途設けてもよい。発色成分または着色 成分としては、昇華性染顔料や電子供与性染料前駆体と 電子受容性化合物、重合性ポリマー等の熱によって物理 的、化学的な変化で画像を形成するもので、従来から種 々検討されているものが使用できる。 例えば、レーザ 一熱転写記録材料の着色成分としては、特に限定するも のではないが、顔料タイプのものとして、二酸化チタ ン、カーボンブラック、酸化亜鉛、プルシアンブルー、 硫化カドミウム、酸化鉄ならびに鉛、亜鉛、バリウム及 びカルシウムのクロム酸塩等の無機顔料やアゾ系、チオ 30 インジゴ系、アントラキノン系、アントアンスロン系、 トリフェンジオキサン系、フタロシアニン系、キナクリ ドン系等の有機顔料が挙げられる。染料としては、酸性 染料、直接染料、分散染料、油溶性染料、含金属油溶性 染料等が挙げられる。

【0090】レーザー感熱記録材料の発色成分として は、特に限定されるものではないが、従来から感熱記録 材料に用いられているものを使用できる。電子供与性染 料前駆体としては、すなわちエレクトロンを供与してま たは酸等のプロトンを受容して発色する性質を有するも のであって、ラクトン、ラクタム、サルトン、スピロピ ラン、エステル、アミド等の部分骨格を有し、電子受容 性化合物と接触してこれらの部分骨格が開環若くは開裂 する化合物が用いられる。例えば、トリフェニルメタン 系化合物、フルオラン系化合物、フェノチアジン系化合 物、インドリルフタリド系化合物、ロイコオーラミン系 化合物、ローダミンラクタム系化合物、トリフェニルメ タン系化合物、トリアゼン系化合物、スピロピラン系化 合物、フルオレン系化合物等が挙げられる。電子受容性 化合物としては、フェノール性化合物、有機酸若くはそ 50 重合・架橋させたボリマーなどを挙げることができる。

40

の金属塩、オキシ安息香酸エステル等が挙げられる。 【0091】「ダイレクト製版用印刷原版]本発明のポ リメチン化合物は、ダイレクト製版用印刷原版の近赤外 線吸収剤として好適に用いることができる。ダイレクト 製版用印刷原版は、支持体上に光熱変換層を設けてな る。また、光熱変換層上にシリコンゴム層を積層しても よいし、更に、保護層等を積層してもよい。

【0092】光熱変換層を構成する成分としては、上記 の本発明のポリメチン化合物以外に、画像形成成分、バ インダー樹脂等がある。あるいは画像形成成分を含む層 を光熱変換層の上に積層して設けてもよい。

【0093】画像形成成分としては、熱によって物理 的、化学的な変化で画像を形成するもので、従来から種 々検討されているものが使用できる。例えば、特開平3 -108588号公報に開示されているマイクロカプセ ル化された熱溶融性物質と結着性樹脂等を含有するも の、昭62-164049号公報に開示されている親水 性表面を有する支持体上に活性水素含有バインダーと共 にブロックイソシアネート等を含有するもの、特開平7 -1849号公報に開示されているマイクロカプセル化 された親油性成分と親水性バインダーボリマー等を含有 するもの、特開平8-220752号公報に開示されて いる酸前駆体、ビニルエーテル基を有する化合物、及び アルカリ可溶性樹脂等を含有するもの、特開平9-59 93号公報に開示されている水酸基を有する高分子化合 物とローナフトキノンジアジド化合物等を含有するも の、特別平9-131977号公報に開示されているニ トロセルロース等を含有するもの、特開平9-1462 64号公報に開示されている重合開始剤及びエチレン性 不飽和モノマー、オリゴマー、マクロモノマー等を含有 するもの等が挙げられ、特に制限はない。

【0094】場合によっては、特開平9-80745号 公報、特開平9-131977号公報、特開平9-14 6264号公報等に開示されているように光熱変換層 (感光層または感熱記録層)上にシリコンゴム層を積層 し、露光後、シリコンゴム層を密着または剥離すること により画像部を形成してもよい。

【0095】光熱変換層に用いられるバインダー樹脂と しては、特に制限はないが、例えば、アクリル酸、メタ クリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル 等のアクリル酸系モノマーの単独重合体または共重合 体、メチルセルロース、エチルセルロース、セルロース アセテートのようなセルロース系ポリマー、ポリスチレ ン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリビニルピロ リドン、ポリビニルブチラール、ポリビニルアルコール のようなビニル系ポリマー及びビニル化合物の共重合 体、ポリエステル、ポリアミドのような縮合系ポリマ ー、ブタジエンースチレン共重合体のようなゴム系熱可 塑性ポリマー、エポキシ化合物などの光重合性化合物を

【0096】本発明の製販用印刷原販は通常の印刷機に セットできる程度のたわみ性を有し、同時に印刷時にか かる加重に耐ええるものでなければならない。すなわ ち、用いる支持体としては、例えば、紙、プラスチック (例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン 等)がラミネートされた紙、例えばアルミニウム(アルミ ニウム合金も含む)、亜鉛、銅等のような金属の板、例 えば二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、酪酸セルロ ース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポ リスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリ 10 ビニルアセタール等のようなプラスチックフィルム等が 挙げられるが、代表的なものとして、コート紙、アルミ ニウムのような金属板、ポリエチレンテレフタレートの ようなプラスチックフィルム、ゴム、あるいはそれらを 複合させたものを挙げることができ、好ましくは、アル ミニウム、アルミニウム含有合金及びプラスチックフィ ルムである。支持体の膜厚は25µm~3mm、好まし くは 100μ m \sim 500 μ mである。

【0097】通常は、ポリメチン化合物、画像形成成分、バインダー樹脂等を有機溶剤等に分散または溶解さ 20 せ支持体に塗布し、製版用印刷原版を作製する。

【0098】塗布する溶剤としては、水、メチルアルコール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、ジアセトンアルコール等のアルコール類、メチルセルソルブ、エチルセルソルブなどのセルソルブ類、トルエン、キシレン、クロロベンゼンなどの芳香族類、酢酸エチル、酢酸ブチル酢酸イソアミル、プロピオン酸メチルなどのエステル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類、塩化メチレン、クロロホルム、トリクロロエチレンなどの塩素系炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類、N,トジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドンなどの非プロトン性極性溶剤等を挙げることができる。

【0099】支持体と光熱変換層との間には、接着性向 後、イソフ 上や印刷特性向上のためのプライマー層を設けてもよい 1)2.9 し、支持体自身を表面処理してもよい。用いるプライマ 【0104 一層としては、例えば、特開昭60-22903号公報 波長(入m に開示されているような種々の感光性ポリマーを光熱変*40 であった。

*換層を積層する前に露光して硬化せしめたもの、特開昭 62-50760号公報に開示されているエポキシ樹脂 を熱硬化せしめたもの、特開昭63-133151号公 報に開示されているゼラチンを硬膜せしめたもの、更に 特開平3-200965号公報に開示されているウレタ ン樹脂とシランカップリング剤を用いたものや特開平3 -273248号公報に開示されているウレタン樹脂を 用いたもの等を挙げることができる。

42

【0100】光熱変換層またはシリコンゴム層の表面保) 護のための保護膜としては、透明なフィルム、例えば、 ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ 塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリエチレン テレフタレート、セロファン等をラミネートしたり、こ れらのフィルムを延伸して用いてもよい。

【0101】本発明のダイレクト製版用印刷原版は、特定発光領域を有する半導体レーザーに対応する。すなわち、この印刷原版を用いて印刷版(刷版)を作製するには、750~900nm、好ましくは770~850nmに発光領域を有する半導体レーザー光源を用いて、従来の公知の製版方法により原版にレーザー光の照射を行い、画像部または非画像部を形成することによりコンピューターなどのデジタルデータを刷版として記録する。【0102】

【実施例】以下に、実施例により本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものでは ない。

【0103】 [実施例1] ポリメチン化合物(具体例化合物(11)の合成)

> 【0104】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大 波長(λmax)及びグラム吸光係数(εg)は以下の通り であった。

元素分析值(C40H52Cl2N2O10): MW=791.8

C H N

計算值(%) 60.68 6.62 3.54 実測值(%) 59.96 6.49 3.58

融点(℃) :152~153℃

λmax :832nm(ジアセトンアルコール溶液)

 $\varepsilon g : 2.80 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物のIRスペクトルを図1に示す。 【0105】得られた化合物のVIS-NIR吸収スペ クトルを図9に示す。 ※【0106】[実施例2] ポリメチン化合物(具体例化合物(12)の合成)

※50 一般式(II)で表される化合物(R1 =メトキシ基、R2

=メトキシエチル基、R3=R4=メチル基、Y=7-メトキシ基、Z= I^- 、n=1)4.05g、一般式(I V)で表される化合物(X=C1)1.80g及び酢酸カリウム3.36gを無水酢酸50m1に加え、45~50で60分撹拌した後、2%KI水溶液300m1へ排出した。析出した結晶物を沪別、水洗後、イソプロパノ*

*ールで再結晶して、具体例化合物(12)2.56gを得た。

【0107】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大波長 (λmax) 及びグラム吸光係数 (ϵg) は以下の通りであった。

元素分析值(C4 0 H5 2 C I I N 2 O6): MW=819. 2

C H N
計算値(%) 58.65 6.40 3.42
実調値(%) 58.36 6.43 3.32
融点(℃) :167~168℃
λmax :832nm(ジアセトンアルコール溶液)
εg :2.65×10⁵ m1/g·cm

得られた化合物のIRスペクトルを図2に示す。

【0108】 [実施例3] ポリメチン化合物(具体例化合物(13)の合成)

実施例1において、一般式(II)で表される化合物として (R₁ =メトキシ基、R₂ =メトキシエチル基、R₃ = R₄ =メチル基、Y=7-メトキシ基、Z=BF₄ - 、n=1)3.65gを、2%KC1O4水溶液300m %20

※1の代わりに2%KBF4水溶液300m1を使用した 以外は実施例1と同様な操作を行って、具体例化合物 (13)2.92gを得た。

【0109】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大波長 (λmax) 及びグラム吸光係数 (ϵg) は以下の通りであった。

元素分析値(C40 H52 BC1F4 N2 O6): MW=779.1

C H N
計算値(%) 61.66 6.73 3.60
実調値(%) 61.39 6.75 3.55
融点(℃) :150~152℃
λmax :832nm(ジアセトンアルコール溶液)

 $\varepsilon g : 2.85 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物のIRスペクトルを図3に示す。 【0110】 [実施例4] ポリメチン化合物(具体例化合物(17)の合成)

★代わりに2%pートルエンスルホン酸水溶液300ml を使用した以外は実施例1と同様な操作を行って、具体 30 例化合物(17)2.72gを得た。

【0111】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大 波長 $(\lambda \max)$ 及びグラム吸光係数 (ϵg) は以下の通り であった。

元素分析値(C43 H51 C1N2 O7S): MW=775.4

C H N
計算値(%) 66.61 6.63 3.61
実測値(%) 65.96 6.72 3.54
融点(℃) :169~171℃
λmax :831nm(ジアセトンアルコール溶液)

 $\varepsilon g : 2.60 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物のIRスペクトルを図4に示す。

【0112】[実施例5] ポリメチン化合物(具体例化合物(19)の合成)

実施例2において、一般式(II)で表される化合物として (R₁ =メトキシ基、R₂ =メトキシエチル基、R₃ = R₄ =メチル基、Y=7-メチル基、Z=C1O₄ ⁻、 n=1)3.61g、2%KI水溶液300m1の代わ☆ ☆りに2%KC104 水溶液300m1を使用した以外は 実施例2と同様な操作を行って、具体例化合物(19) 3.05gを得た。

【0113】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大波長 $(\lambda \max)$ 及びグラム吸光係数 (ϵg) は以下の通りであった。

元素分析值(C40H52Cl2N2O8): MW=759.8

C H N

計算値(%) 63.23 6.90 3.69 実測値(%) 62.87 6.85 3.73

融点(℃) :197~198℃

 λmax : 822 nm(ジアセトンアルコール溶液)

 $\varepsilon g : 3.12 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物のIRスペクトルを図5に示す。

【0114】得られた化合物のVIS-NIR吸収スペクトルを図10に示す。

【0115】[実施例6] ポリメチン化合物(具体例化合物(47)の合成)

*スルホネート、n=1)4.34g、2%KC1O4水 溶液300m1の代わりに2%pートルエンスルホン酸 水溶液300m1を使用した以外は実施例1と同様な操作を行って、具体例化合物(47)の化合物2.70gを 10 得た。

46

【0116】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大波長 $(\lambda \max)$ 及びグラム吸光係数 (ϵg) は以下の通りであった。

元素分析值(C47H59CIN2O7S): MW=831.5

 . C
 H
 N

 計算値(%)
 67.89
 7.15
 3.37

 実現値(%)
 67.20
 7.24
 3.45

融点(℃) :205~207℃

 λmax : 822nm(ジアセトンアルコール溶液)

 $\varepsilon g : 2.80 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物のIRスペクトルを図6に示す。

【0117】 [実施例7] ポリメチン化合物(具体例化合物(51)の合成)

一般式(II)で表される化合物(R₁ =メトキシ基、R₂ 酸ナト =3-スルホプロビル基、R₃ = R₄ =メチル基、Y = ノール 7-メチル基、n=0)3.25gを、一般式(IV)で表 した。 される化合物(X=C1)1.80g及び酢酸カリウム (51] 3.36gを無水酢酸50mlに加え、65~70℃で 【01 60分攪拌した後、イソプロパノール200mlを加 (入m え、更に同温度で60分攪拌した。蒸発乾固後、酢酸工※30 った。

※チル100mlを加え、室温で1時間撹拌した。析出した結晶物を沪別し、酢酸エチル10mlで洗浄後、メタノール100mlで再結晶した。得られた結晶物を、酢酸ナトリウム2g、メタノール100ml、イソプロパノール100mlの溶液に溶解させ、常圧下溶媒を留去した。析出した結晶物を沪別、乾燥して、具体例化合物(51)2.30gを得た。

【0118】この化合物の元素分析値、吸収極大波長 (Amax)及びグラム吸光係数(eg)は以下の通りであ

元素分析值(C40H50ClN2NaO8S2): MW=809.4

 C
 H
 N

 計算値(%)
 59.36
 6.23
 3.46

 実測値(%)
 58.69
 6.37
 3.37

融点(℃) : 260~261℃以上(分解)

λmax : 824nm(ジアセトンアルコール溶液)

 $\varepsilon g : 2.82 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物のIRスペクトルを図7に示す。

【0119】得られた化合物のVIS-NIR吸収スペクトルを図11に示す。

【0120】 [実施例8] ポリメチン化合物(具体例化合物(55)の合成)

実施例2において、一般式(II)で表される化合物(R₁ =メトキシ基、R₂ =メトキシエチル基、R₃ =R₄ = メチル基、Y=7-メチル基、Z=BF₄ - 、n=1) ★

- ★3.62g、2%KI水溶液300mlの代わりに2% KBF4水溶液300mlを使用したを用いた以外は実
- 40 施例2と同様な操作を行って、具体例化合物(55)2. 20gを得た。

【0121】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大波長 (λmax) 及びグラム吸光係数 (ϵg) は以下の通りであった。

元素分析値(C40H52BC1F4N2O4): MW=747.1

 C
 H
 N

 計算值(%)
 64.30
 7.02
 3.75

 実測值(%)
 64.21
 6.91
 3.70

 融点(℃)
 :198~199℃

:822nm(ジアセトンアルコール溶液) λmax

 $\varepsilon g : 3.20 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物のIRスペクトルを図8に示す。

【0122】 [実施例9] ポリメチン化合物(具体例

化合物(55)の無定形物の作製)

実施例8で得られた具体例化合物(55)2.0gをアセ

トン20m1に溶解し、濃縮、乾燥することにより、具*

*体例化合物(55)の無定形物1.95gを得た。

【0123】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大 波長(λ max)及びグラム吸光係数(ϵ g)は以下の通り

48

であった。

元素分析值(C40H52BC1F4N2O4): MW=747.1

С Н Ν

計算值(%) 64.30 7.02 3.75 実測値(%) 64.24 6.99 3.69

融点(℃) : 不明瞭

:822nm(ジアセトンアルコール溶液) λmax

 $\varepsilon g : 3.18 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物の粉末X線回折図を図12に示す。

※物(55)のB晶1.42gを得た。

【0124】 [実施例10] ポリメチン化合物(具体

例化合物(55)の8晶の作製)

実施例8で得られた具体例化合物(55)2.0gをメタ

ノール30m1より再結晶することにより、具体例化合※

【0125】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大 波長 (λmax) 及びグラム吸光係数 (ϵg) は以下の通り

であった。

元素分析值(C40H52BC1F4N2O4): MW=747.1

Н

計算值(%) 64.30 7.02 3.75 6.96 3.71

実測値(%) 64.25 融点(℃) : 204~206℃

λmax :822nm(ジアセトンアルコール溶液)

 $\varepsilon g : 3.21 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物の粉末X線回折図を図13に示す。 【0126】 [実施例11] ポリメチン化合物(具体 例化合物(55)のメタノール溶媒和物の作製)

実施例8で得られた具体例化合物(55)2.0gをメタ 30 【0127】この化合物の融点、吸収極大波長(Ama

★7gまで減圧濃縮し、冷却、沪取、乾燥することによ り、具体例化合物(55)のメタノール溶媒和物1.92 gを得た。

ノール50m1に溶解し、エバポレーターにて濃縮残量★ x)及びグラム吸光係数(εg)は以下の通りであった。

融点(℃) :~180℃

:822nm(ジアセトンアルコール溶液) λmax

 $\varepsilon g : 2.92 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物の粉末X線回折図を図14に示す。

実施例12 ポリメチン化合物(具体例化合物(55)の α晶の作製)

実施例9で得られた具体例化合物(55)の非結晶物1. 5gをメタノール20m1に室温下分散することによ ☆

☆り、具体例化合物(55)のα晶1.23gを得た。

【0128】この化合物の元素分析値、融点、吸収極大 波長(λ max)及びグラム吸光係数(ϵ g)は以下の通り

であった。

元素分析值(C40H52BC1F4N2O4): MW=747.1

С Н N 計算值(%) 64.30 7.02 3.75 64.21 実測値(%) 6.93 3.71

融点(℃) :195~197℃

λmax :822nm(ジアセトンアルコール溶液)

 $\varepsilon g : 3.20 \times 10^5 \text{ ml/g} \cdot \text{cm}$

得られた化合物の粉末X線回折図を図15に示す。

◆とともに測定した。これらの結果を表1に示す。

【0129】 [最大吸収波長] 本発明のポリメチン化合

[0130]

物のジアセトンアルコール溶液中での最大吸収波長(入

【表1】

max)を公知の化合物である前記化合物A、化合物B ◆50

A	lmax
具体例化合物(11)	832nm
具体例化合物(12)	832nm
具体例化合物(13)	832nm
具体例化合物(17)	831nm
具体例化合物(19)	822nm
具体例化合物(47)	822nm
具体例化合物(51)	824nm
具体例化合物(55)	822nm
化合物A	788nm
化合物B	812nm

【0131】[溶解度試験]本発明のポリメチン化合物のメチルエチルケトンに対する溶解度を公知の化合物である前記化合物A、化合物Bとともに測定した。溶解度の測定は下記の方法に従って行った。

【0132】溶解度の測定方法

5mlのスクリュー管へ各ポリメチン化合物200mg 20 及びメチルエチルケトン1mlを入れ、Mix-Rot orにて、25℃で一晩撹拌溶解し、不溶物の有無を目 視で確認した。不溶物が無い場合を溶解度20%以上、*

*不溶物が残存している場合を20%未満とした。

【0133】ポリメチン化合物200mgの代わりに、各ポリメチン化合物150mg、100mg、50mg、30mg及び10mgを用いた以外は同じ操作を行って、同様にして溶解度を測定した。これらの結果を表2に示す。

50

【0134】 【表2】

	溶解皮 (g/ml)	
具体例化合物(11)	20%以上	
具体例化合物 (12)	10%以上15%未満	
具体例化合物(13)	20%以上	
具体例化合物 (19)	20%以上	
具体例化合物(47)	20%以上	
具体例化合物 (55)	20%以上	
化合物A	3%以上5%未満	
化合物B	1%以上3%未満	

表1、表2の具体例化合物(55)は実施例8で合成した化合物を用いて測定した。

【0135】[実施例13] 近赤外線吸収剤の製造 平均厚さ5μmのポリエチレンテレフタレート(PET) フィルムにバインダーとしてデルペット80N(旭化成工業(株)製;アクリル系樹脂);10g、具体例の化合物(11);0.2gをトルエン/メチルエチルケトン(1/1)混合溶媒90gに溶解した液を、ワイヤーバーで乾燥後の膜厚が約5μmとなるよう塗布して試料とした。

【0136】単一モード半導体レーザー(波長830 nm)のレーザー光をレンズで集光し、上記試料の表面で ビーム径10μmとなるように配置した。表面に到達するレーザーのパワーが50~200mWの範囲で変化できるように半導体レーザーを調整し、20μsのパルス幅で単一のパルスを試料に照射した。照射を完了した試※50

※料を光学顕微鏡で観察したところ、表面に到達するレー ザーのパワーが50mW時、直径約10μmの貫通した 孔が形成されていることが確認できた。

【0137】[実施例14] 近赤外線吸収剤の製造 実施例13において、具体例の化合物(11); 0.2g の代わりに具体例の化合物(19); 0.2gを用いた以 外は実施例9と同様の操作を行った。照射を完了した試 料を光学顕微鏡で観察したところ、表面に到達するレー ザーのパワーが50mW時、直径約10μmの貫通した 孔が形成されていることが確認できた。

【0138】[実施例15] ダイレクト製阪用印刷原 阪の作製

(下塗り層の形成)厚さ175μmのポリエチレンテレフタレートフィルム上にプライマー層として、乾燥膜厚0.2μmとなるようにゼラチン下塗り層を形成した。【0139】(光熱変換層の形成)下記の成分で作成した

塗布液を前記のゼラチン下塗りポリエチレンテレフタレ *層を形成した。

ート上に乾燥膜厚2µmとなるように塗布し、光熱変換*

具体例の化合物(11)

0.1重量部

52

クリスポン3006LV

5.0重量部

(大日本インキ化学工業(株)製ポリウレタン)

ソルスパースS27000(ICI社製)

0.4重量部

ニトロセルロース(n-プロパノール30%含有)

4. 2重量部

キシリレンジアミン1モル/グリシジルメタクリレート4モルの付加物

エチルミヒラーズケトン

2. 0重量部

テトラヒドロフラン

0.2重量部 90 重量部

【0140】(シリコンゴム層の形成)下記の成分で作成

※るように塗布し、シリコンゴム層を形成した。

した塗布液を前記の光熱変換層上に乾燥膜厚2μmとな※

 α , ω -ジビニルポリジメチルシロキサン(重合度約700) 9.0重量部

 $(CH_3)_3 Si-0-(SiH(CH_3)-0)_8 -Si(CH_3)_3$

0.6重量部

ポリジメチルシロキサン(重合度約8000)

0.5重量部

オレフィンー塩化白金酸

0.08重量部

抑制剤 HC≡C-C(CH₃)₂-O-Si(CH₃)₃

0.07重量部

アイソパーG(エッソ化学(株)製)

55 重量部

【0141】上記のようにして得られた印刷用原版に、 版面上のパワーが110mWとなるようにピーム径10 μm、発振波長830nmの半導体レーザーを用いて書 き込みを行った。レーザー記録感度は200mJ/cm 2、解像力8µmでシャープなエッジの印刷版が形成で きた。

【0142】[実施例16] ダイレクト製版用印刷原 阪の作製

実施例15において、具体例の化合物(11); 0. 1重 量部の代わりに具体例の化合物(47); 0. 1重量部を 用いた以外は実施例11と同様の操作で印刷用原版を作 30 製した。

【0143】上記のようにして得られた印刷用原版に、 阪面上のパワーが110mWとなるようにビーム径10 μm、発振波長830nmの半導体レーザーを用いて書 き込みを行った。レーザー記録感度は200mJ/cm 2、解像力8μmでシャープなエッジの印刷版が形成で

【0144】[実施例17] ダイレクト製版用印刷原 販の作製

20★実施例15において、具体例の化合物(11); 0.1重 量部の代わりに表1の化合物(55):0.1重量部を用 いた以外は実施例11と同様の操作で印刷用原版を作製 した。

【0145】上記のようにして得られた印刷用原版に、 版面上のパワーが110mWとなるようにビーム径10 μm、発振波長830 nmの半導体レーザーを用いて書 き込みを行った。レーザー記録感度は200mJ/cm 2、解像力8µmでシャープなエッジの印刷版が形成で

【0146】 [比較例1] 実施例13において、具体例 の化合物(11); 0.2gの代わりに特開昭63-31 9191号公報記載の下記構造式のポリメチン化合物; 0.2gを用いた以外は実施例13と同様の操作を行っ た。照射を完了した試料を光学顕微鏡で観察したとこ ろ、表面に到達するレーザーのパワーが100mWにお いても貫通した孔は形成されなかった。

[0147] 【化35】

c10₁⊖

【0148】 [比較例2] 実施例13において、具体例 の化合物(11); 0.2gの代わりにJournal ofOrgani c Chemistry, 60, 2392, Table 1. 記載の下記構造式のポリ メチン化合物; 0.2gを用いた以外は実施例13と同 様の操作を行った。照射を完了した試料を光学顕微鏡で☆ ☆観察したところ、表面に到達するレーザーのパワーが5 OmWにおいては貫通した孔は形成されなかった。

化合物A

[0149]

【化36】

[0150]

【発明の効果】一般式(I)のボリメチン化合物は、可視域の吸収が小さく、この化合物を含有する近赤外線吸収剤は、レーザー光に対する感度が良好で光熱変換効率が高く、例えば、高速記録ができ、高密度、高画質の画像10を与えるレーザー熱転写記録材料、レーザー感熱記録材料等に好適に用いることができる。また、一般式(I)のボリメチン化合物は、ダイレクト製販用印刷原販の光熱変換層の作製に用いる種々の溶剤に対する溶解性が極めて高く、種々のバインダー樹脂等との相溶性が良いため塗工液が調整しやすく、均一な光熱変換層を形成できるため、ダイレクト製販用印刷原販の製造に特に適している。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1のポリメチン化合物のIR吸収スペク 20 トルである。

【図2】実施例2のポリメチン化合物の I R吸収スペクトルである。

【図3】実施例3のポリメチン化合物の I R吸収スペクトルである。

【図4】実施例4のポリメチン化合物の I R吸収スペクトルである。

*【図5】実施例5のポリメチン化合物の I R吸収スペクトルである。

【図6】実施例6のポリメチン化合物のIR吸収スペクトルである。

) 【図7】実施例7のポリメチン化合物の I R吸収スペク トルである。

【図8】実施例8のポリメチン化合物のIR吸収スペクトルである。

【図9】実施例1のポリメチン化合物のジアセトンアルコール中のVIS-NIR吸収スペクトルである。

【図10】実施例5のポリメチン化合物のジアセトンアルコール中のVIS-NIR吸収スペクトルである。

【図11】実施例7のポリメチン化合物のジアセトンアルコール中のVIS-NIR吸収スペクトルである。

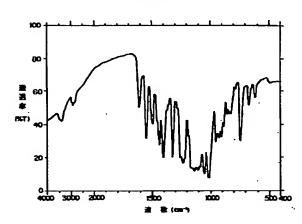
【図12】実施例9のポリメチン化合物の粉末X線回折 図である。

【図13】実施例10のポリメチン化合物の粉末X線回 折図である。

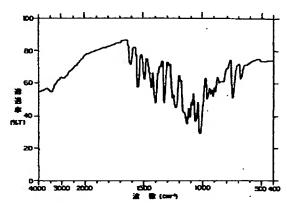
【図14】実施例11のポリメチン化合物の粉末X線回 折図である。

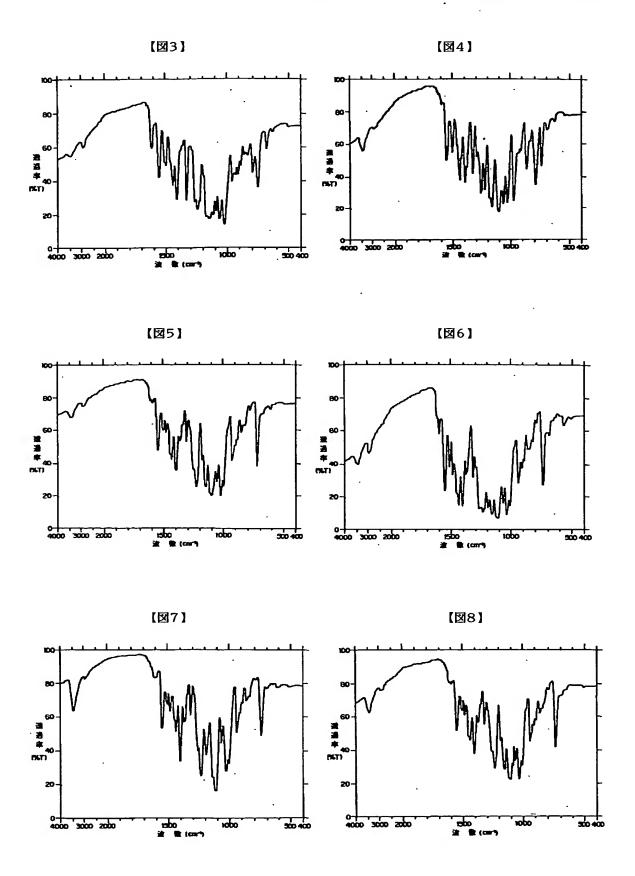
【図15】実施例12のポリメチン化合物の粉末X線回 折図である。

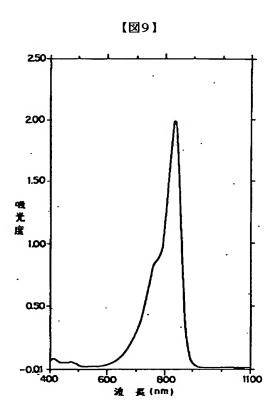
【図1】

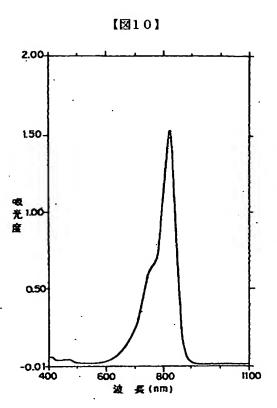


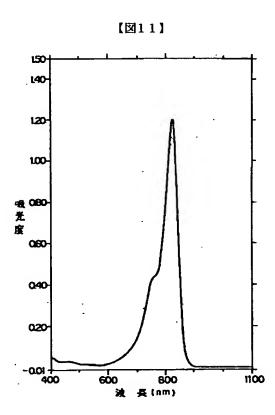
【図2】



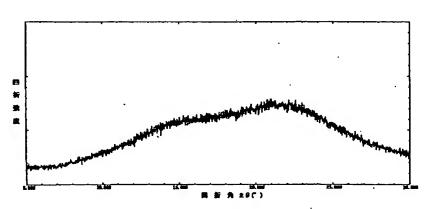




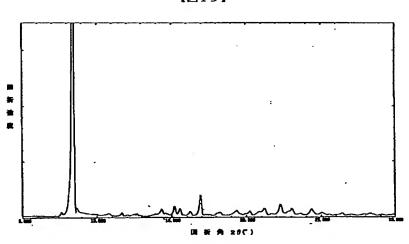




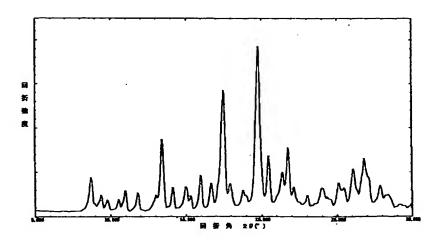
【図12】



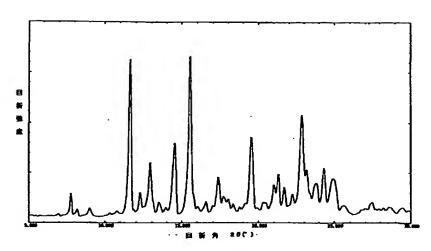
【図13】



【図14】



【図15】



フロントページの続き

(51) Int. Cl . ⁷		識別記号	· FI		テーマユード(参考)
C09K	3/00	105	C09K	3/00	105
G03C	1/20		G03C	1/20	
G03F	7/004	505	G03F	7/004	505
G03G	5/05	104	G03G	5/05	104B

(72)発明者 千々石 圭希

大阪府八尾市弓削町南1丁目43番地 山本 化成株式会社内 (72)発明者 岩崎 泰久

大阪府八尾市弓削町南1丁目43番地 山本 化成株式会社内